

# INFORMACION TECNICA



**SIDASA**

PROCESOS PARA EL TRATAMIENTO DE SUPERFICIES



UNITS COATING GROUP

## QUIMAL CLEAN RP

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

● Aspecto:	liquido incoloro
● Composición:	disolventes parafínicos y siloxanos
● Densidad a 20°C:	0,770 g/cc
● Viscosidad a 40°C:	4,1 cst

### APLICACIONES

**QUIMAL CLEAN RP** es un producto líquido, base solventes y siliconas, de alta actividad, que proporciona una película fina y uniforme, evitando adherencias y restos de abrasivos sobre la superficie de aluminio y sus aleaciones. Es un producto neutro que no ataca el sustrato tratado

### MODO DE EMPLEO

Pulverizar sobre la superficie a tratar o bien aplicar directamente sobre un paño, que después limpiará la superficie eliminando restos de suciedad y confiriendo a la misma un acabado brillante y de tacto sedoso.

**El producto no debe usarse sobre un sustrato que deba ser pintado posteriormente ya que no es compatible con las pinturas.**

El producto se suministra en envases de 25 lts o en sprays.

### PRECAUCIONES

Producto a base de solventes relativamente volátiles, usar alejado de fuentes de llamas. No se debe calentar y se debe usar con ventilación adecuada. Puede producir irritación en los ojos si entra en contacto con ellos. En ese caso, lavar con agua abundante, y si persistiera la molestia, acudir a un facultativo

PL/230804

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico. Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciatarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos.